

立式激光平面干涉仪

立式激光平面干涉仪为正立式结构，通光口径有200mm，150mm和100mm三种，正立式结构兼容了平面元件的平放测量、拼盘测量和高精度测量。立式结构比卧式测量效率更高。

G200M，G150M和G100M专为计量和科研需求设计，适用于计量机构检定和校准光学平晶。其集高性能、长寿命氦氖激光器，高清光学系统，1-6倍图像放大功能和精密平面标准镜等一系列高精技术，选配Sirius抗振移相干涉条纹分析软件，实现高精平面光学元件的测量。



G200M和G150M

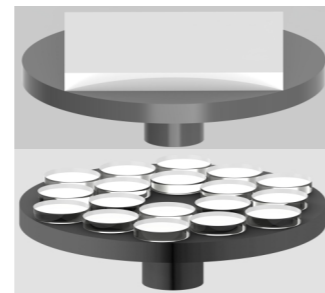
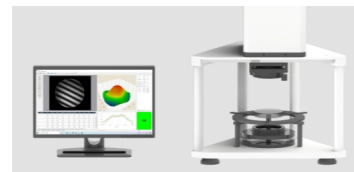
G100M

应用

▶ 光学平晶、陶瓷和晶圆等平面度测量

▶ 平面窗口的平行度和透过波前测量

▶ 光学车间的盘上和拼盘测量



特点

- ▶ 可选配TFH平面透过标准镜，无需使用衰减膜，对反射率2%到99%的样品测量；
- ▶ 可选配短相干光源，解决平行平板面形测量时自身干涉条纹的影响；
- ▶ 针对正立式结构优化标准镜参数，确保透射标准镜的面形和系统精度；
- ▶ 只需将样品放在载物台上，无抓夹变形，可快速更换样品；
- ▶ 150和200口径的4个型号载物台可通过导轨前后平移，方便大尺寸磨具移动，分区域测量。

仪器规格参数表

产品型号	G150MHD	G100MHD	G150M	G100M	G200M
结构形式	正立式（镜头在上）				
测量方式	菲索干涉原理				
有效通光口径	152.4mm	101.6mm	152.4mm	101.6mm	200mm
光源	稳频氦氖激光（632.8nm），相干长度 > 100m				
相机	靶面2/3"，有效分辨率2Kx2K		靶面1/1.2"，有效分辨率1.2Kx1.2K		
主机空间分辨率	全口径分辨条纹数 > 450对		全口径分辨条纹数 > 350对		
测量模式	Sirius抗振移相分析软件				
Pv重复性(2σ)	<λ/500				
RMS重复性(2σ)	<λ/10000				
连续变焦倍数	1-6倍				
移相方式	压电陶瓷机械移相				
对准方式	十字线精对准与快速对准结合，对准角度±3°				
光瞳调焦范围	±5.5m	±2.5m	±5.5m	±2.5m	±2.5m
平面透射标准镜	进口熔石英，PV：优于λ/20				进口熔石英 PV：优于λ/15
平面反射标准镜	进口微晶，PV：优于λ/20				进口微晶 PV：优于λ/15
系统精度	PV：优于λ/20				PV：优于λ/15
干涉腔内尺寸mm(长宽高)	450X450X525	540×360×360	450X450X525	540×360×360	450X450X525
仪器尺寸mm(长宽高)	560×560×1310	640×400×1100	560×560×1310	640×400×1100	560×560×1268
仪器重量	130KG	90KG	130KG	90KG	150KG
电源	100-240VAC, 50/60Hz				
工作环境温度	15°C - 30°C				
温度变化率	< 1.0°C/30min				
湿度	不大于70%				
隔振	机械移相测量模式推荐使用被动隔振系统				
质量标准	GJB/J 6221-2008				